⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑫ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-150051

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

④公開 平成4年(1992)5月22日

H 01 L C 23 C 21/68 N

8624-4M

21/304

3 4 1

9046-4K 8831-4M

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全5頁)

会発明の名称

ウエハ把持装置

頭 平2-274566 创特

22出 願 平2(1990)10月12日

明 者 個発 川島 英 顕

東京都千代田区大手町2丁目6番3号 新日本製鐵株式會

社内

②出 願 人 新日本製鐵株式会社

東京都千代田区大手町2丁目6番3号

のの代理 人 弁理士 國分 孝悦

1. 発明の名称

ウエハ把持装置

2. 特許請求の範囲

ウエハの外周近傍に接触してそのウエハを回転 可能に把持し得る複数の把持部材と、

これら把持部材により回転可能に把持された前 記ゥェハの外周部に対して接触及び離間自在に構 成され、その接触状態でモータによって回転駆動 されて前記ウエハを回転させる回転体と、

この回転体を移動させて前記ウェハの外周部に 対して接触及び離間させる駆動機構と、

を具備するウェハ把持装置。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、半導体装置の製造工程において使用 されるウエハ把持装置に関する。

「従来の技術」

半導体装置の製造工程においてウエハに対して 各種の処理を行う際、ウェハを真空中または液体 中で肥持することが多いが、従来から、その把持 装置としては、ウエハの外周近傍を機械的に把持 するものが主流である。

例えば、第4図は枚葉式のウェハ洗浄装置にお けるウェハ把持装置の一従来例を示すものであり、 ウエハ1の外周近傍の3箇所をそれぞれ把持具2 によって把持して洗浄槽3の洗浄液4の中に投入 させ、この状態でウェハIを浸漬或いは揺動させ ることによって、ウェハ1の表塞両面を洗浄して いる.

(発明が解決しようとする課題)

しかしながら、上述したように従来は、ウェハ に対して各種の処理を行う際、ウェハの外周近傍 を機械的に肥持するので、そのウェハの把持され ていた部分の処理状態が他の部分に比べて署しく 悪いという問題があった。

例えば、第4図に示したような従来のウェハ洗 浄装置におけるウエハ把持装置では、洗浄中にウ エハ1の外周近傍を把持具2によって把持するの で、そのウエハトの把持されていた部分Pがどう

しても未洗浄部分として残り、その部分Pの洗浄 状態が他の部分に比べて著しく悪くなる。

そこで本発明は、ウエハを把持して各種の処理 を行う際に、そのウエハの把持されていた部分も 他の部分と同様に処理することができるウエハ把 持装置を提供することを目的とする。

〔課題を解決するための手段〕

上記目的を達成するために、本発明によるウエハ把持装置は、ウェハの外周近傍に接触してそのウェハを回転可能に把持し得る複数の把持部材により回転で把持された前記ウェルの外周部に対して接触でモータによって回転駆動されて前記ウェルを回転させる回転をといて前記ウェルの外周部に対して接触及び離間させる駆動機構とを具備するものである。(作用)

上記のように構成された本発明によれば、駆動 機構によって回転体がウエハの外間部に接触され、 モータによって回転体が回転駆動されると、ウエ

各把持部材10の移動は、図外の駆動機構によって行われる。また、本体基板20はウエハ洗浄装置の移動アーム等(図示せず)の先端に取付けられ、その本体基板20の中央部には円形の開孔21が設けられている。

次に、本体基板20の一部には突出部22が一体に設けられ、この突出部22上にモータ30が 取付けられている。そして、モータ30のモータ ハが肥持部材によって把持された状態で回転される。これによって、把持部材に対するウエハの位置が変わり、それまで把持部材により把持されていた部分が露呈される。 従って、ウエハを把持さてて各種の処理を行う際に、そのウエハの把持されていた部分の処理が可能になる。 例えば、ウエハの洗浄時に、把持されていた未洗浄部分の洗浄が可能になる。

(実施例)

以下、本発明をウェハ洗浄装置におけるウェハ 把持装置に適用した一実施例を第1図~第3C図 を参照して説明する。

まず、第1図及び第2図に示すように、このウエハ把持装置は、円周上で等間隔置きに配置された3個の把持部材10を有している。これら把持部材10は全て同一のものであり、その前端には円弧状のV字溝からなる把持部11が形成されている。そして、各把持部材10は円形の本体基板20上に取付けられ、それぞれ径方向である矢印a、a、方向へ移動自在に携成されている。なお、

軸30aにアーム31が固着され、このアーム31の先端下面にモータ32が取付けられている。 そして、モータ32のモータ軸32aに回転体であるローラ33が固着されている。なお、モータ30及びアーム31によって駆動機構が構成される。

従って、アーム31はモータ30によって矢印 b、b'方向へ回動されると、ローラ33が2つの把 時部材10のほぼ中間位置でカエハ1の外周 が大りのほぼ中間位置でカエハ1の外周向 が大りのはぼ中間位置でカエハ1の外周向 が大りの手間である。がカエハ1の外間の が大りに接触され、アーム31が大ハ1の外間の が大りに対している。 である。に接近ではないのではない。 であるように構成されている。 であるように構成されない。 ないったないので、かっている。 も摩託し難いものを使用する。

次に、上述のように構成されたウェハ把持装置 の動作を説明する。

まず、洗浄槽の外部で把持装置にウェハ1が装

者される。即ち、第1図において、矢印a 方向 へ移動された各把持部材 10の間にウエハ 1が押 入され、各把持部材 10が矢印 a 方向へ移動され て、把持部 11がウエハ 1の外間エッジ 1 a の近 傍に保合される。

この把持状態で、第3A図に示すように、ウエハ1が洗浄槽3内に没入され、洗浄液4によってウエハ1の前半の洗浄が行われる。このとき、ローラ33はウエハ1の外周エッジ1aから離間されている。なお、第2図に示すように、本体基板20に設けられた開孔21によって、本体基板20とウエハ1との間にも洗浄液4を充分に波動させることができる。

所定の洗浄が終了すると、第1図の実線状態及び第2図に示すように、モータ30によってアーム31が矢印 b 方向へ回動され、ローラ33がウエハ1の外周エッジ1aに接触される。これとほは同時に、各把持部材10が矢印a′方向へ一定ストロークだけ移動され、ウエハ1が回転可能な状態となる。そして、モータ32によってローラ

われる。

以上のように、第3A図に示す洗浄工程の前半が終了した後、第3B図に示すようにウェハーを回転させると、各把持部材10に対するウェルカリの位置が変わり、それまで各把持部材10に、が発達されていた部分Pが露呈される。従って、の洗浄時に各把持部材10により把持されて、で、第3C図に示すをおける。ののに対して、の名部分Pがする。の回転時間は予め数定されている。

なお、上述した前半の洗浄、ウエハ1の回転、 後半の洗浄の後、さらにウエハ1の回転及び洗浄 を何回綴り返してもよい。そして、最終的に洗浄 が終了すると、ウエハ1が洗浄槽3内から取り出 され、各把持部材10が矢印a 方向へ移動され てウエハ1が脱着される。

以上、本発明の一実施例に付き説明したが、本 発明は実施例に限定されることなく、本発明の技 33が矢印 c 方向へ回転駆動される。これによって、第3B 図に示すように、ウェハ l は各把持部材 l 0によって把持された状態で矢印 d 方向へ回転されて行く。

なお、予め回転駆動されるローラ33をウエハ 1の外間エッジ1aに接触させてから、ウエハ1 の把持状態を弛めてもよいが、こうすると、把持 状態が弛む間にウエハιが各把持部材10によっ て擦られる恐れがあるので、前述したように、予 めウエハ1を回転可能な状態にした後、ローラ3 3を回転させるのが好ましい。

ローラ33が一定時間だけ回転駆動されて、ウェハ1が一定角度だけ回転されると、第1図において、モータ32が停止されると共に、モータ30によってアーム31が矢印 b ′方向へ回動され、ローラ33がウェハ1の外間エッジ1aから離間される。そして、各把持部材10が矢印 a 方向へ移動され、把特部11が再びウェハ1の外間エッジ1aの近傍に係合される。この把持状態で、第3C図に示すように、ウェハ1の後半の洗浄が行

術的思想に基づいて各種の有効な変更並びに応用 が可能である。

例えば、実施例では把持部材を一定ストロークだけ移動させてウェハを回転可能に把持したが、 把持部材は実質的にウェハを回転可能に把持し得 るものであればよく、常にウェハを回転可能に把 持するものでもよい。また、その把持部材の構成 は各種の変更が可能である。

また、回転体を移動させる駆動機構としては、 実施例以外に、回転体を支持する部材をプランジャによって駆動する構成等も採用することができ

なお、本発明は、ウェハ洗浄装置におけるウェ ハ把持装置以外に、半導体装置の製造工程におい てウェハを把持する各種のウェハ把持装置に応用 可能である。

(発明の効果)

以上説明したように、本発明によれば、把持部 材によってウェハを把持した状態で回転体によっ てウェハを回転させることができる。従って、ウ エハを把持して各種の処理を行う際に、そのウエハを回転させることによって、 把持されていた部分も他の部分と同様に処理することができる。 例えば、ウエハの洗浄時に、 そのウエハを回転させることによって、把持されていた未洗浄部分の洗浄が可能になり、ウエハの全体を極めて効果的に洗浄することができる。

また、本発明によれば、回転体によってウエハを極めて円滑かつ確実に回転させることができると共に、回転時以外は回転体がウエハから離間されるので、ウエハに対する各種の処理時に回転体は全く障害にならない。

4. 図面の簡単な説明

第1図〜第3 C図は本発明をウェハ洗浄装置におけるウェハ把持装置に適用した一実施例を示す ものであって、第1図はウェハを把持した状態の 正面図、第2図は第1図Ⅱ−Ⅱ線での断面図、第 3 A図〜第3 C図は洗浄時の概略図である。

第4図はウェハ洗浄装置におけるウェハ把持装置の一従来例を示す概略図である。

なお、図面に用いた符号において、

1 1 …………把持部

2 0 …… … 本体基板

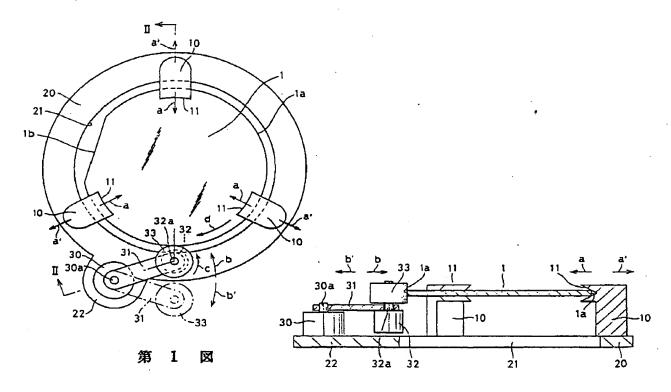
. 30モータ

3 1 7 - 4

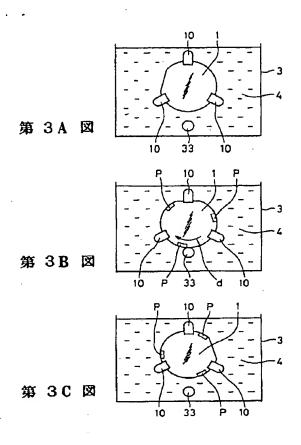
3 2 …………モータ

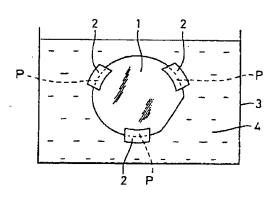
である.

出願人 新日本製鐵株式會社 代理人 弁理士 國分孝悦



第 2 図





第 4 図